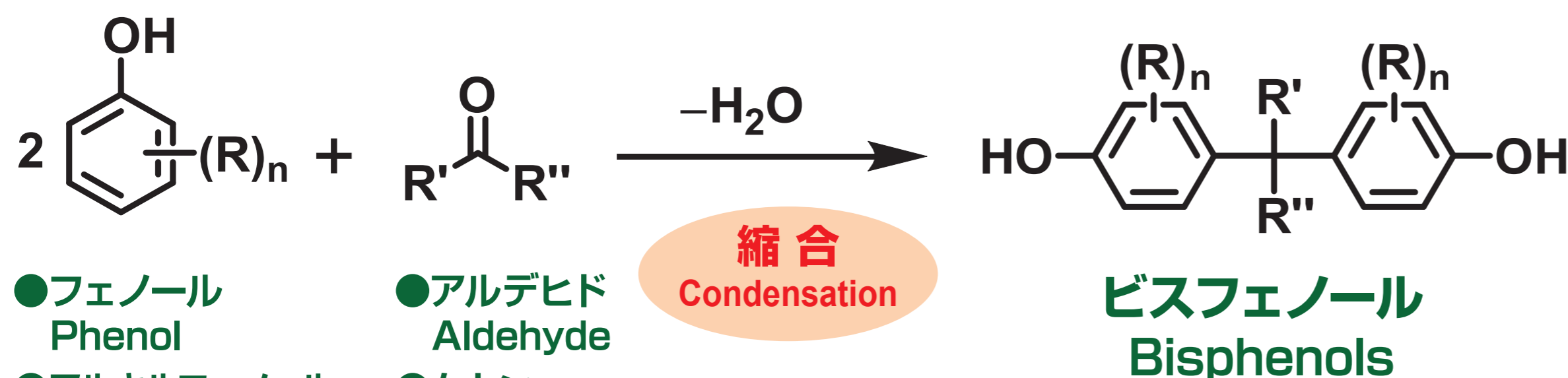


特殊ビスフェノール Specialty Bisphenols

高機能部材に使われる特殊ポリカーボネート、特殊エポキシ樹脂の原料である特殊ビスフェノールを製造販売しております。

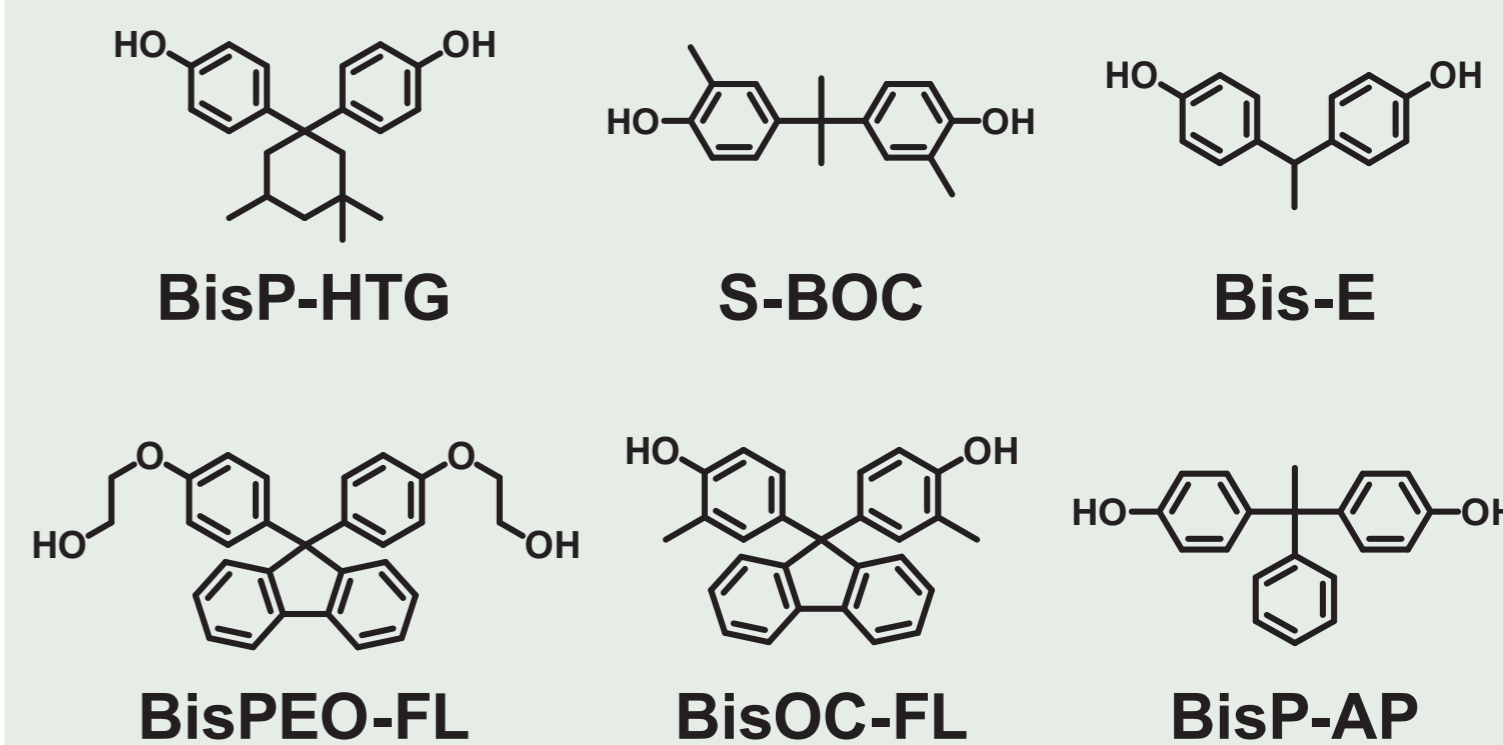
Specialty Bisphenols are supplied as the raw materials for the high functional resins, such as the specialty polycarbonate and the specialty epoxy resin.



- フェノール Phenol
- アルキルフェノール Alkyl Phenol
- アルデヒド Aldehyde
- ケトン Ketone

多様なビスフェノール製品の生産が可能
Various kinds of Specialty Bisphenols can be produced.

特殊ビスフェノールの例 Examples of Specialty Bisphenols



特殊ビスフェノールに求められる性能 / 用途例 Required Characteristics / Application Examples

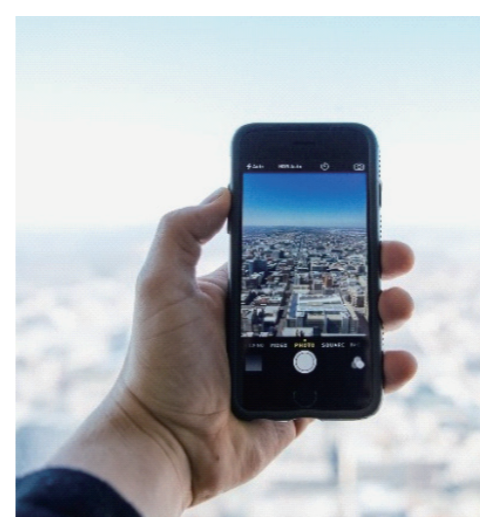
●高耐熱ポリカ High Heat Resistance Polycarbonate



高耐熱と成形性を両立
High heat resistance with good formability

自動車部品
Automobile parts and components

●高屈折ポリカ High Refractive Index Polycarbonate



高屈折率と成形性を両立
High refractive index with good formability

スマホカメラレンズ
Smartphone Camera Lens

分子設計により相反する特性を両立
To satisfy incompatible characteristic requirements simultaneously by molecular design.

電子材料 Electronic materials

半導体及びフラットパネルディスプレイの製造過程で使用されるフォトレジストの材料を主に製造販売しております。

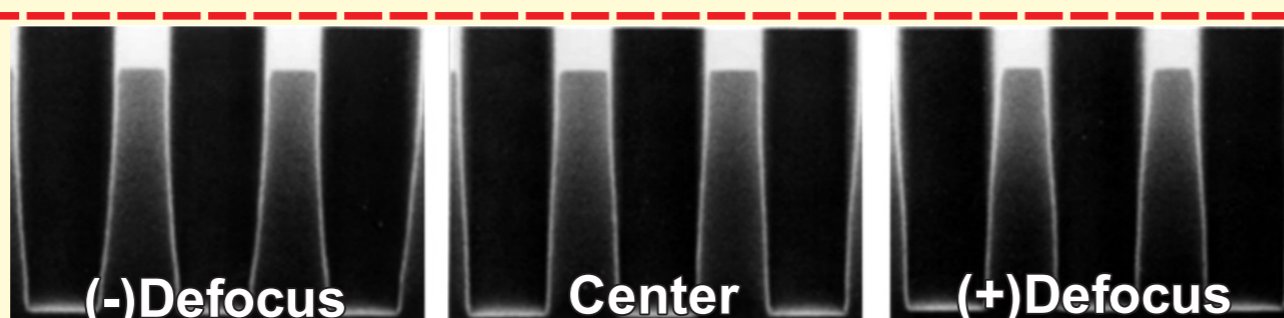
Our products are mainly used as photoresist materials for the manufacturing process of semiconductor and flat panel display.

■ 製品紹介 Product introduction

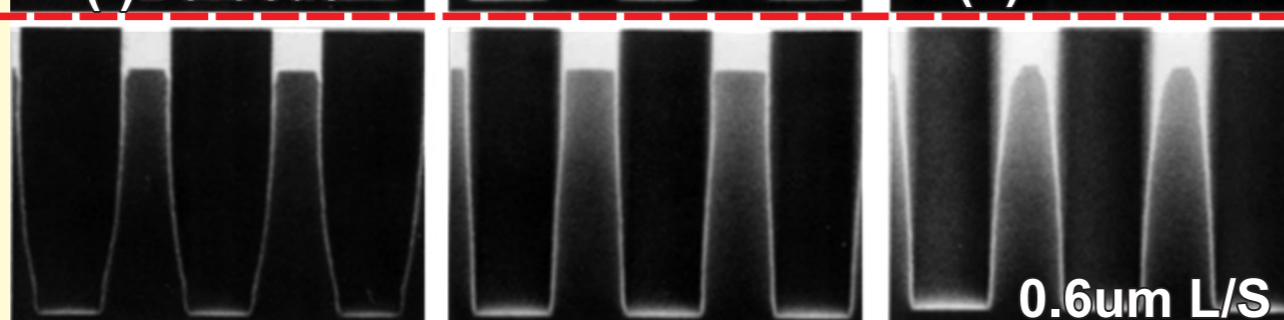
Product name	TrisP-PA	TekOC-4HBPA	2,3,5-TMP
Chemical Structure			
CAS No.	110726-28-8	53091-59-1	697-82-5
Application	Additive, Raw materials for photo active compound	Additive, Raw materials for photo active compound	Monomer for phenol resin (Novolak)

■ 弊社製品添加有無によるレジストパターンの比較 Comparison of resist patterns with and without our product (additive).

添加あり
With additive



添加なし
No additive



フォトレジストには様々な性能が要求されますが、主にパターン形成性能を高めるために当社材料が使用されています。

Various performance is required for photoresist, our material is mainly used to raise pattern formation performance.